



# 2025年7月期 第3四半期 決算概要

2025年6月11日(水)  
サムコ株式会社  
証券コード:6387

# 25/7月期 第3四半期の実績

( 2024.8.1 ~ 2025.4.30 )

# 25/7月期第3四半期 業績ハイライト

過去最高

過去最高

売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益
62.4億円 (+8.4%)	13.9億円 (+7.9%)	13.7億円 (△1.0%)	9.6億円 (△0.4%)

- 売上高は4期連続で過去最高を更新
- 営業利益は過去最高
- 為替差損発生により経常利益・四半期純利益は減益
- 受注高は65.7億円（前年同期比16.1%増）
- 受注残高56.9億円（前年同期比7.0%増）

# 25/7月期第3四半期(累計) 実績報告

(単位:百万円)

	24/7月期 第3四半期実績	25/7月期第3四半期		
		実績	前年同期比	当初計画
売上高	5,759	6,241	8.4 %	6,525
売上総利益	2,852	3,067	7.5%	3,173
売上高総利益率	49.5 %	49.1 %	—	48.6%
営業利益	1,291	1,393	7.9%	1,456
営業利益率	22.4 %	22.3%	—	22.3 %
経常利益	1,384	1,370	△1.0%	1,470
四半期純利益	972	968	△0.4%	1,001

- 生産用途向けの販売で遅れが出たが概ね予想通りに推移しており、販売価格の値引き抑制、操業度向上などにより、売上高総利益率は高水準を維持

# 25/7月期第3四半期 装置別売上高

(単位:百万円)

	24/7月期第3四半期		25/7月期第3四半期		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
CVD装置	1,135	19.7 %	1,198	5.6%	19.2 %
エッティング装置	3,192	55.5 %	3,649	14.3 %	58.5 %
洗浄装置	456	7.9 %	420	△ 7.8 %	6.7 %
部品・メンテナンス	975	16.9 %	973	△0.2 %	15.6 %
合計	5,759	100.0 %	6,241	8.4 %	100.0 %

【CVD装置】 半導体レーザー向け(化合物半導体分野)と光学デバイスのシリコンフォトニクス向けでの販売

【エッティング装置】 半導体レーザー向け(化合物半導体分野)や欠陥解析向け(シリコン半導体分野)、シリコンフォトニクス向け、高周波フィルタ向け(電子部品分野)での販売

【洗浄装置】 各種基板の前洗浄(電子部品分野)、医療機器用部品(ヘルスケア関連分野)での販売

# 25/7月期第3四半期 用途別売上高

(単位:百万円)

	24/7月期第3四半期		25/7月期第3四半期		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
化合物半導体分野	2,248	39.1 %	1,626	△27.7%	26.1 %
シリコン半導体分野	1,021	17.7 %	1,465	43.5%	23.5 %
電子部品分野	384	6.7 %	1,051	173.6%	16.8 %
ヘルスケア関連分野	64	1.1 %	125	95.4%	2.0 %
その他	1,065	18.5 %	999	△6.2%	16.0 %
部品・メンテナンス	975	16.9 %	973	△0.2%	15.6 %
合計	5,759	100.0 %	6,241	8.4 %	100.0 %

【化合物半導体分野】 光通信の半導体レーザー、LED、次世代パワーデバイス向けでの販売

【シリコン半導体分野】 シリコンフォトニクス、欠陥解析、量子デバイス向けでの販売

【電子部品分野】 高周波フィルタ、量子デバイス向けでの販売

# 25/7月期第3四半期 目的別売上高

(単位:百万円)

	24/7月期第3四半期		25/7月期第3四半期		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
生産用	2,125	36.9 %	2,018	△5.0 %	32.3 %
研究開発用	2,658	46.2 %	3,249	22.2 %	52.1 %
部品・メンテナンス	975	16.9 %	973	△0.2 %	15.6 %
合計	5,759	100.0 %	6,241	8.4 %	100.0 %

【生産用】 エッティング装置を中心に、半導体レーザー、欠陥解析向けなどで販売

【研究開発用】 CVD装置(ALD装置を含む)、エッティング装置の半導体レーザー、共用研究設備

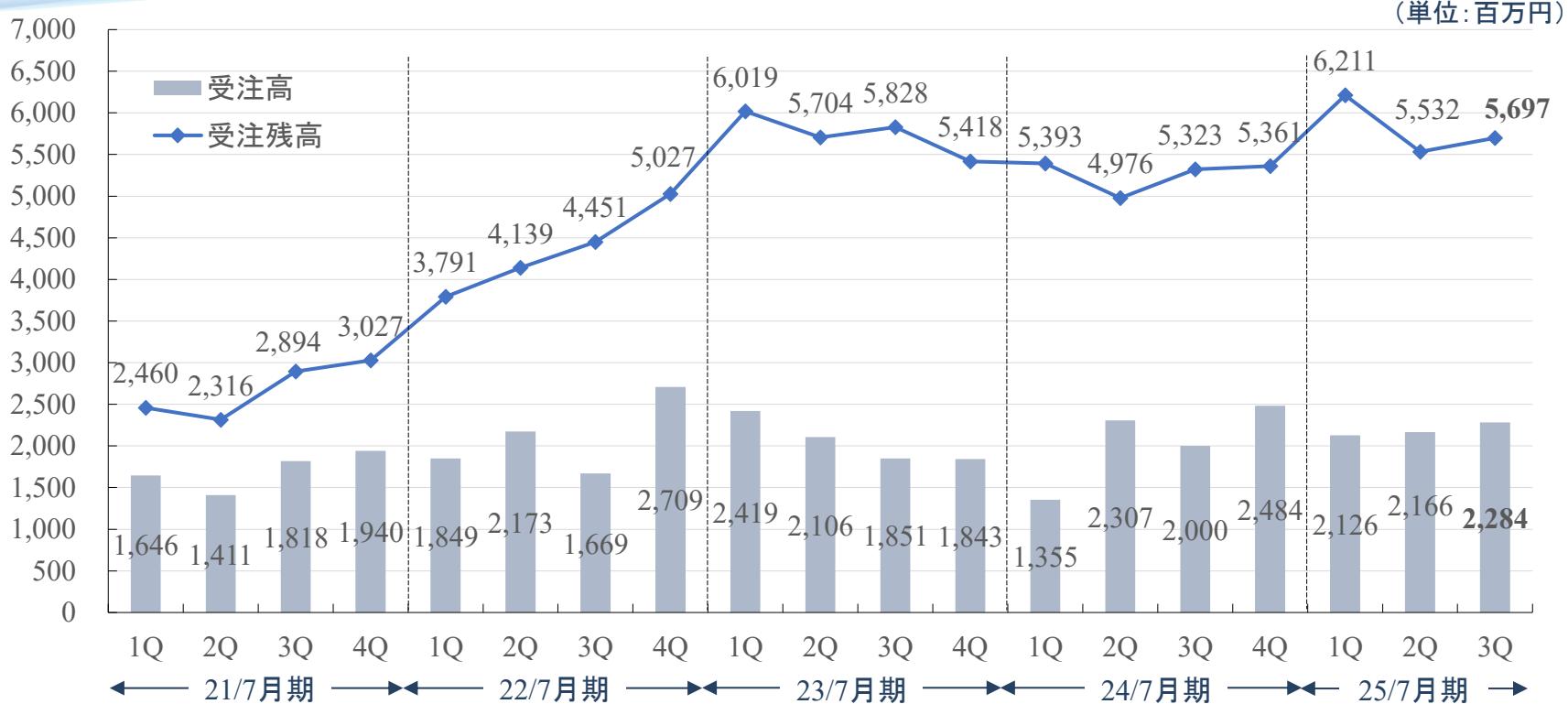
# 25/7月期第3四半期 地域別売上高

(単位:百万円)

	24/7月期第3四半期		25/7月期第3四半期		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
(国内)	3,196	55.5 %	4,126	29.1%	66.1 %
(海外合計)	2,562	44.5 %	2,114	△17.5 %	33.9 %
アジア	2,036	35.4 %	1,443	△29.1 %	23.1 %
北米	523	9.1 %	474	△9.3 %	7.6 %
欧州	2	0.0 %	188	6680.3 %	3.0 %
その他	0	0.0 %	8	5056.1%	0.1 %
合計	5,759	100.0 %	6,241	8.4 %	100.0 %

- 海外売上高比率 33.9%(通期計画42.1%)
- アジア市場:中国782百万円、台湾302百万円、韓国239百万円

# 受注環境(受注高、受注残高)の変化



# 25/7期事業計画

( 2024.8.1 ~ 2025.7.31 )

# 年度計画および配当予想の修正(2025年5月15日開示)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回予想(A)	百万円 9,500	百万円 2,200	百万円 2,240	百万円 1,530	円 銭 190.48
今回修正(B)	<b>9,160</b>	<b>2,290</b>	<b>2,280</b>	<b>1,550</b>	<b>192.96</b>
増減額(B-A)	△340	70	40	20	
増減率(%)	△3.6	3.2	1.8	1.3	
(ご参考)前期実績	8,203	2,017	2,088	1,471	183.25

- 売上高は4期連続で過去最高を更新するものの前回発表予想を下回る見通し
- 販売価格の値引き抑制、操業度向上などにより、売上高総利益率は高水準を維持
- 営業利益は5期連続、経常利益と当期純利益は6期連続で過去最高を更新する見通し

本資料の著作権その他の一切の権利は、サムコ株式会社に属しております。複製、転送、第三者への配布等を無断で行わないようお願い申し上げます。

# 年度計画 目標数値

(単位:百万円)

	24/7月期 実績	25/7月期 計画(2025年5月修正)		
		上半期 実績	下半期 計画	通期
売 上 高	8,203	4,121	5,039	9,160
売 上 総 利 益	4,193	2,106	2,504	4,610
営 業 利 益	2,017	990	1,300	2,290
経 常 利 益	2,088	1,011	1,269	2,280
当 期 純 利 益	1,471	714	836	1,550
海 外 売 上 高 比 率	46.3 %			43.7%
R O E	12.6 %			11.5 %
1株当たり当期純利益(円)	183.25			192.96

# 参考資料

# 会社概要

商 号 サムコ株式会社 Samco Inc.

代 表 者 代表取締役会長 兼 CEO 辻 理(つじ おさむ)  
代表取締役社長 兼 COO 川邊 史(かわべ つかさ)

設 立 1979年(昭和54年)9月1日

本社所在地 〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36

事 業 内 容 半導体等電子部品製造装置の製造及び販売

売 上 高 82億315万円 (2024年7月期)

従 業 員 183名 (2024年7月)

証 券 コード 6387 (東京証券取引所 プライム市場)



左:川邊 史、右:辻 理

 最新の会社案内は[こちら](#)

 当社のビジネスモデルは[こちら](#)

# 沿革(創業～2010年)

1979年9月	半導体製造装置の製造及び販売を目的として株式会社サムコインターナショナル研究所を設立
1980年7月	半導体プロセス用大型CVD(Chemical Vapor Deposition)装置の開発、販売を開始
1984年7月	東京都品川区に東京出張所(現東日本営業部)を開設
1987年2月	米国カリフォルニア州にオプトフィルムズ研究所を開設
1997年11月	キリンビール株式会社と共同で、プラスチックボトルにDLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)膜を形成する技術を開発
2001年5月	日本証券業協会に株式を店頭上場
2004年12月	株式会社サムコインターナショナル研究所からサムコ 株式会社へ社名を変更
2010年4月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ市場(2013年7月より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))に上場



沿革の詳細は[こちら](#)

# 沿革(2011年～現在)

2013年7月	東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)から市場第二部へ市場変更
2014年1月	東京証券取引所市場第二部から同第一部銘柄に指定
2014年5月	リヒテンシュタイン公国UCP Processing Ltd.の株式90%を取得し子会社化(samco-ucp AGに社名変更)
2016年9月	Aqua Plasmaを用いたプラズマ洗浄装置AQ-2000の開発、販売を開始
2020年7月	第二生産技術棟内にCVD装置のデモルームを開設
2021年12月	電子デバイス製造向けクラスターツールシステム「クラスターH™」の販売を開始
2022年3月	第二研究開発棟内にナノ薄膜開発センターを立ち上げ
2022年4月	東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場へ移行



沿革の詳細は[こちら](#)

# 国内拠点、海外拠点



京都地区



本社



研究開発センター



第二研究開発棟



製品サービスセンター



生産技術研究棟



第二生産技術研究棟

上記に加えて研究開発用の新棟を建設中（2025年春に稼働予定）



## 海外営業・サービス拠点（計11拠点）

海外売上高比率46.3%（2024年7月期実績）

現地の営業・サービス人員を強化し、海外市场の開拓を図る。

⇒インド・ベンガルールオフィスを開設（2022年7月）

各事業拠点の詳細は[こちら](#)

# 経営理念、経営方針

Mission

## 経営理念

- 企業の永続的な発展を追求し、適正な利益を確保することにより、企業を巻く利害関係者とともに成長する企業を目指して、  
薄膜技術で世界の産業科学に貢献する。

## 経営方針

1. 社員の創造性を重視し、常に独創的な薄膜技術を世界の市場に送る。
2. 直販体制を採用し、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供する。
3. 事業が社会に果たす役割を積極的に認識し、高い付加価値を目標とし、株主、取引先、役員、従業員に対し、適切な成果の配分をする。

# グローバル中堅企業

Vision

## サムコの目指すグローバル中堅企業

1. 世界中で自由にビジネスを展開し、自社の独自技術を活かし、質の高い製品とサービスを提供し続ける。
2. コア技術（薄膜技術）をベースに、参入障壁の高い領域において、特定の製品で圧倒的シェアを有することで、自ら製品に値付けが出来る力を持ち、高い収益率を維持し続ける。
3. 売上の規模を求めるだけでなく、継続的に利益を稼げる市場に特化、集中する。
4. 組織体制は少数精銳のプロ集団である。
5. 適正な税金を納め、国家や地域の発展にも貢献する。

# 製品ラインナップ



deposition

## ■CVD (Chemical Vapor Deposition) 装置

- ALD (Atomic Layer Deposition) 装置
- プラズマCVD装置
- 液体ソースCVD®装置



etching

## ■ドライエッティング装置

- ICP (Inductively Coupled Plasma) エッティング装置
- シリコン深掘り装置
- RIE (Reactive Ion Etching) 装置



surface  
treatment

## ■ドライ洗浄装置

- Aqua Plasma® クリーナー
- プラズマクリーナー
- UVオゾンクリーナー

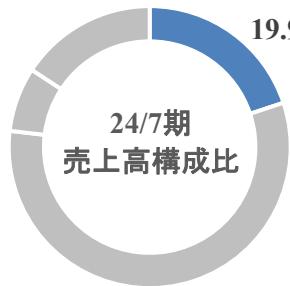


# 品目別売上高 CVD装置



## 装置ラインナップ

- ・ALD (Atomic Layer Deposition) 装置
- ・プラズマCVD装置
- ・液体ソースCVD®装置



## 概要

反応性の気体を基板上に供給し、化学反応によって薄膜を形成する装置で、一般に半導体、電子部品製造のための半導体膜、絶縁膜、金属膜などを形成するために使われます。当社が開発したLS (Liquid Source) -CVD装置では、引火爆発性のあるガスを使用せず安全性に優れた液体原料を用いて、低温で均一性に優れた薄膜を高速で形成することが可能であります。

2015年12月から販売を開始した原子層堆積装置 (ALD = Atomic Layer Deposition) はCVD装置に分類しております。ALD装置は、反応室に有機金属原料と酸化剤を交互に供給し、表面反応のみを利用して成膜を行う装置であり、高い膜厚制御性と良好な段差被覆性を実現することが可能であります。

第45期有価証券報告書(2024.10.22提出)より



CVD装置の詳細は[こちら](#)



CVD装置とは ⇒[こちら](#)  
(半導体製造装置入門より)

# 品目別売上高 エッチング装置



## 装置ラインナップ

- ・ICP (Inductively Coupled Plasma) エッチング装置
- ・シリコン深掘り装置
- ・RIE (Reactive Ion Etching) 装置
- ・XeF<sub>2</sub>ドライエッティング装置



## 概要

各種半導体基板上の半導体薄膜、絶縁膜をはじめ微細加工が必要な材料をドライ加工する装置で、反応性の気体をプラズマ分解し、目的物と反応させて蝕刻いたします。当社独自のトルネードICP (Inductively Coupled Plasma = 高密度プラズマ)を利用するエッティング装置では、高密度プラズマを安定して生成し、高速で高精度の微細加工が可能であります。

第45期有価証券報告書(2024.10.22提出)より



エッティング装置の詳細は[こちら](#)



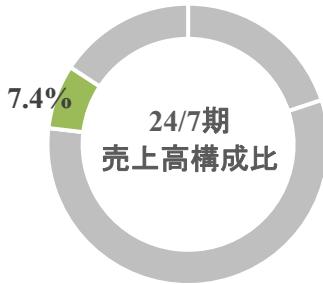
エッティング装置とは ⇒[こちら](#)  
(半導体製造装置入門より)

# 品目別売上高 洗浄装置



## 装置ラインナップ

- ・Aqua Plasma® クリーナー
- ・プラズマクリーナー
- ・UVオゾンクリーナー



## 概要

実装基板や各種半導体基板などを溶液を用いずドライ洗浄する装置で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて処理する装置や紫外線と高濃度オゾンの併用で処理する装置などがあります。当社のドライ洗浄装置は、ウェット洗浄では難しい超精密洗浄を高効率で行うことが可能であります。

2016年9月より販売を開始した水蒸気(H<sub>2</sub>O)を用いたプラズマ処理装置であるAqua Plasma(アクアプラズマ)洗浄装置は、金属酸化膜の還元、有機汚れの洗浄、樹脂接合、超親水化などの表面処理を、安全で環境に優しく行うことが可能であります。 第45期有価証券報告書(2024.10.22提出)より



洗浄装置の詳細は[こちら](#)



洗浄装置とは ⇒[こちら](#)  
(半導体製造装置入門より)

# 品目別売上高 部品・メンテナンス

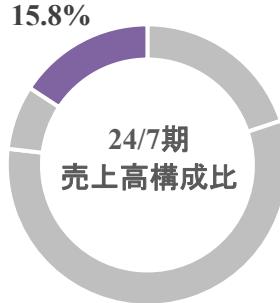
## 主な内訳

- ・部品、消耗品
- ・修理、改造
- ・移設、作業
- ・メンテナンス

## 概要

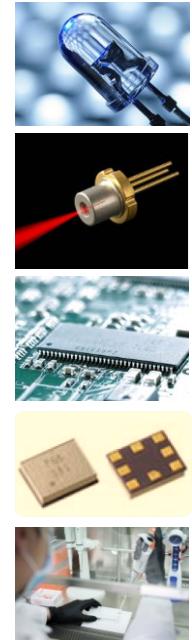
当社装置の納品後のアフターサービスに係る売上を、部品・メンテナンスの売上高として計上しております。交換用の部品や消耗品をはじめ、装置の修理や改造、また装置の移設やそれに伴う作業費、メンテナンス費用等があります。

第45期有価証券報告書(2024.10.22提出)より



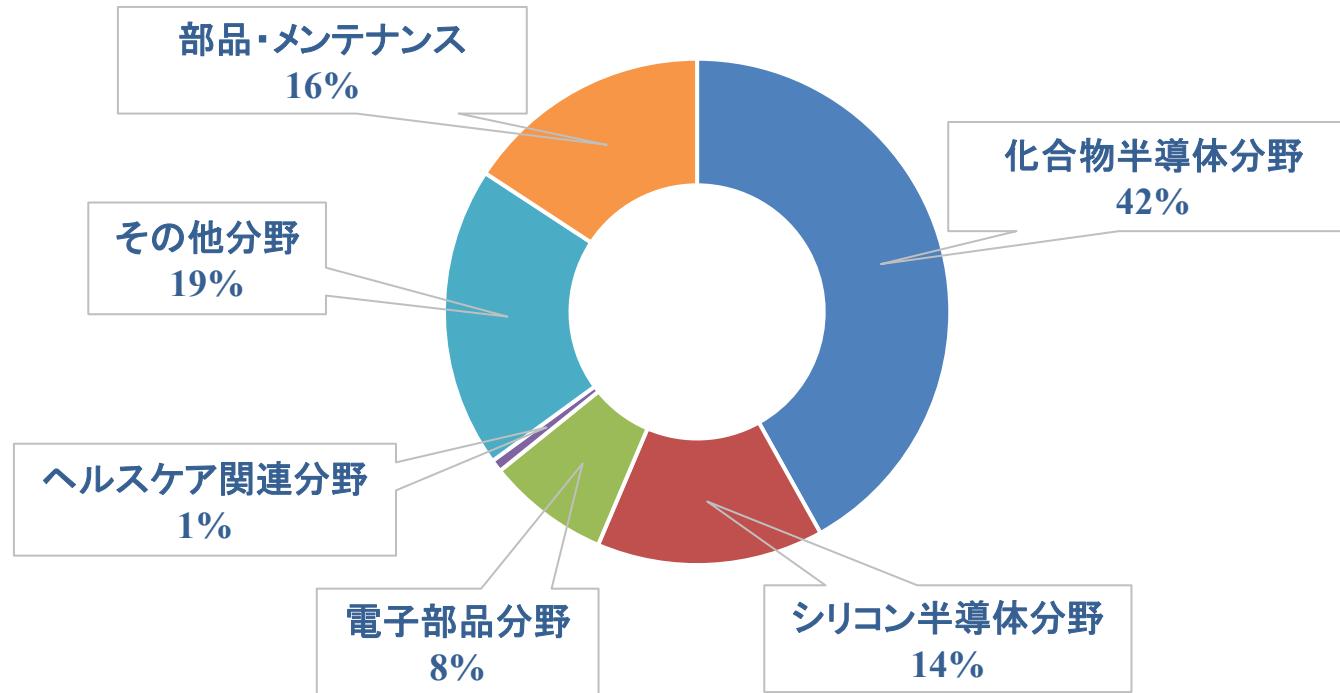
# 用途別売上高区分

用 途	概 要
化合物半導体分野	GaN(窒化ガリウム)、GaAs(ガリウムひ素)、InP(インジウムリン)、SiC(炭化シリコン)などの化合物を材料に用いた半導体デバイスの加工用途です。化合物半導体はLEDや半導体レーザーといった光デバイス、電力の制御や增幅に使われるパワーデバイスや高速通信を実現するHEMT(High Electron Mobility Transistor)などの高周波デバイスに用いられます。
シリコン半導体分野	シリコンウェハーの欠陥解析及びシリコン半導体に関する加工用途です。
電子部品分野	半導体を除く電子部品の加工用途です。主にMEMS (Micro Electro Mechanical Systems 微小電気機械システム)、コンデンサ、インダクタ、各種センサー、高周波フィルターが含まれます。
ヘルスケア関連分野	マイクロ流体デバイスなどヘルスケアに関する加工用途などです。
その他	大学等の共用設備向けの装置など上記以外の加工用途です。
部品・メンテナンス	部品・メンテナンスに関する売上であります。



第45期有価証券報告書(2024.10.22提出)より

# 用途別売上高構成比 (2024年7月期 実績)



# 当社製品が用いられるアプリケーション(例)



MEMS



TSV



SiCパワーデバイス



GaNパワーデバイス



LED

様々なアプリケーションの製造工程に  
当社の製品が使用されています。



半導体レーザ(LD)



光導波路



フォトニック結晶



GaAs高周波デバイス



SAWデバイス

# 事業領域 化合物半導体の例

化合物半導体は、複数の異なる元素を組み合わせて作ることで、シリコンのような単元素の半導体では実現できない特性を得ることができます。

高速で動作する、高い耐熱性、低消費電力、発光するなどの優れた特性を持っており、スマートフォンの高周波デバイスやLD、LED、次世代パワーデバイスなどの材料として利用されています。

デバイスの例	材料の例	最終製品・用途の例
LD(半導体レーザー)	GaAs、InGaAsP、InP	スマートフォン顔認証システム、自動車の自動運転システム、無線基地局・衛星、光通信
LED、マイクロLED	GaN、AlInGaP、GaP	液晶ディスプレイ、照明、自動車ヘッドライト
パワーデバイス	SiC、GaN、Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	鉄道車両インバーター、電気自動車の充電ユニット、データセンター、ノートパソコン等の急速充電器

# 地域別売上高区分

当社では、当社の製品が使用される地域(国)によって、売上高を以下の地域に区分しております。

地 域	対象となる国
日 本	日本国内
ア ブ	台湾、中国、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピン、インド ほか
北 米	米国、カナダ、メキシコ
欧 州	ブルガリア、ドイツ、イギリス、フィンランド、ポルトガル、スペイン、イタリア、トルコ、スウェーデン ほか
その他	オーストラリア、エジプト ほか

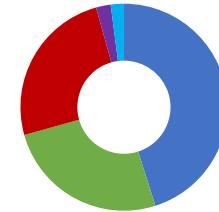
当社 第45期有価証券報告書(2024.10.22提出)より

# 株式の状況（2025年1月末時点）

- ・発行可能株式総数 14,400,000株
- ・発行済株式の総数 8,042,881株
- ・株主数 8,683名
- ・大株主の状況

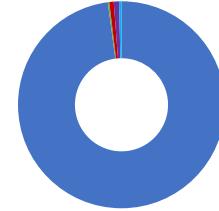
株主名	持株数 (株)	持株比率 (%)
一般財団法人サムコ科学技術振興財団	1,000,000	12.4
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	946,000	11.8
辻 理	863,807	10.7
サムコエンジニアリング株式会社	850,282	10.6
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	250,700	3.1
辻 一美	201,465	2.5
野村信託銀行株式会社(投信口)	157,200	2.0
株式会社三菱UFJ銀行	129,600	1.6
立田 利明	103,099	1.3
三菱UFJキャピタル株式会社	102,931	1.3

所有者別株式分布状況（株式数ベース）



■個人・その他	3,625,582株	(45.1%)
■金融機関	2,058,100株	(25.6%)
■その他の法人	2,009,151株	(25.0%)
■外国法人等	184,951株	(2.3%)
■金融商品取引業者	165,097株	(2.1%)

所有者別株式分布状況（株主数ベース）



■個人・その他	8,499名	(97.9%)
■金融機関	21名	(0.2%)
■その他の法人	59名	(0.7%)
■外国法人等	71名	(0.8%)
■金融商品取引業者	33名	(0.4%)

# 主要数値の変遷

	21/7月期	22/7月期	23/7月期	24/7月期	25/7月期 (予想)
売上高(百万円)	5,746	6,401	7,830	8,203	9,160
営業利益(百万円)	989	1,371	1,858	2,017	2,290
営業利益率(%)	17.2	21.4	23.7	24.6	25.0
経常利益(百万円)	1,044	1,481	1,927	2,088	2,280
当期純利益(百万円)	755	1,052	1,366	1,471	1,550
総資産(百万円)	12,069	13,379	14,795	16,116	17,640
自己資本(百万円)	9,410	10,057	11,144	12,299	13,466
自己資本比率(%)	78.0	75.2	75.3	76.3	76.3
ROE(%)	8.3	10.8	12.9	12.6	11.5
減価償却費(百万円)	95	76	57	83	80
設備投資額(百万円)	737	234	33	276	857
研究開発費(百万円)	264	255	242	262	292
EPS(円)	94.09	131.07	170.07	183.25	192.71
配当金(円)	30	35	45	45	60

# ESG・サステナビリティ



# 持続可能な社会の実現に向けて サムコの取り組み

## 経営理念 ～薄膜技術で世界の産業科学に貢献する～

<b>E 環境</b>	<p>«気候変動・脱炭素への取り組み»</p> <ul style="list-style-type: none"><li>TCFD提言に基づいた情報開示。ESG委員会の活動による気候変動への対応状況把握、対策。</li><li>環境方針(2006年制定)に沿った取り組みを実施。</li></ul> <p>«環境配慮型製品»</p> <ul style="list-style-type: none"><li>省エネ・脱炭素を支えるLED、レーザー、次世代パワーデバイスの製造などを支える装置メーカー。</li><li>コア技術である最先端の“薄膜技術”をベースに世界中の製造現場や研究者へ装置を提供。</li><li>主な取り組みテーマ ①製品容積の減少、②消費エネルギーの削減、③会社消費電力量の削減、 ④グリーン調達、⑤廃棄物の削減</li></ul>
<b>S 社会</b>	<p>«事業を通じた社会的価値の創造»</p> <ul style="list-style-type: none"><li>顧客価値、取引先価値、社会的価値、株主価値、従業員価値の創造</li></ul> <p>«社会貢献、地域貢献»</p> <ul style="list-style-type: none"><li>サムコ科学技術振興財団による若手研究者への支援活動</li><li>京都工織纖維大学への寄附講座、東高瀬川ビジネスコミュニティへの参画</li><li>従業員、会社からの寄付金活動。(日本赤十字社、京都大学ほか／ウクライナ支援、能登半島地震義援金)</li></ul>
<b>G ガバナンス</b>	<p>«ガバナンス体制、ダイバーシティ»</p> <ul style="list-style-type: none"><li>役員12名中、社外役員6名(うち女性1名)←2024年10月22日開催の定時株主総会にて承認</li><li>取締役会の実効性評価による改善、検討。</li><li>多様な人材確保。(女性管理職の登用、外国籍社員の積極採用、中途採用含めた中核人材の多様性、シニア社員の活躍)</li></ul>

上記の取り組みに限らず、様々なチャレンジを続けることで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

## SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

### 当社が重点的に取り組むSDGs



各取り組みの詳細は[こちら](#)

# サステナビリティに関する取り組み

取り組みテーマ	概 要
製品容積の減少	半導体製造装置の製造現場では、多大な電力を要するクリーンルームでの効率的な装置配置が不可欠です。そのためには、フットプリントの削減が重要なポイントとなります。更に小さなサイズの装置とすることで納品時における移送コストの削減を行うことができます。
消費エネルギーの削減	より少ない電力消費で当社装置を稼働できるよう省電力が可能となる部品の選択や構成の見直しなどを恒常的に行ってまいります。
会社消費電力量の削減	当社業務活動における電力消費、温室効果ガスの排出量削減を目指した取り組みを行ってまいります。
グリーン調達	当社では、環境に配慮した原材料・部品を優先的に調達するグリーン調達を、調達先企業と協力して推進しております。
廃棄物の削減	事業活動に伴い排出される廃棄物の量の削減・リサイクル製品の利用促進に継続的に取り組んでおります。

# TCFD対応

## 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)

G20財務大臣・中央銀行総裁会議の要請を受け、金融安定理事会(FSB)により2015年12月に設立された「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略称。  
「ESG委員会」より、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標について当社ホームページ上で開示。



## ESG委員会

気候変動に係るリスク及び機会、自社の事業活動や収益に与える影響についてのデータ収集と分析を行うため、代表取締役社長を委員長とする「ESG委員会」設置。  
⇒活動内容を取締役会に年1回以上報告  
⇒財務への影響や中長期経営計画への影響等に対する検討を行う。



# 省エネ、脱炭素社会実現を支えるサムコの技術



サムコの“薄膜技術”は省エネ・脱炭素を支えるLED、次世代パワーデバイスなどを支えています。

当社のコア技術である最先端の“薄膜技術”をベースに、SDGsに関連する環境・社会・ガバナンスの視点から研究開発、人材育成に注力。

最先端の製造装置を世界中の製造現場や研究者へ提供し、省エネ、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

# サムコとSDGsの関わり

- ・当社の主な事業領域である半導体・電子部品製造装置事業は、SDGsの目標を達成するためには欠かせない技術です。
- ・SDGsの17の目標では、経済、産業、社会等の課題を取り扱っていますが、当社では、創業以来、「企業の永続的な発展を追究し、適正な利益を確保することにより、企業を巻く利害関係者と共に成長する企業を目指して、薄膜技術で世界の産業科学に貢献する。」という経営理念を掲げて、社会への貢献に重きを置いてきました。

事業との関連性が高い以下の項目について、重点的に取り組んでまいります。



# サムコのSDGsの取り組み例



3 すべての人に 健康と福祉を	<ul style="list-style-type: none"><li>・マイクロ流体チップ、医療用ドライ滅菌装置の製造に当社アキュアプラズマ技術の寄与を目指す。</li><li>・深紫外LED空気清浄機(コロナウィルス不活性化)製造に当社装置が寄与。</li><li>・医療機器、エコーヘッドセンサーの製造に当社装置が寄与。</li><li>・日本赤十字社への寄付。(ウクライナ人道危機救援金、能登半島地震災害支援金、トンガ大津波支援等)</li></ul>
4 良い教育を みんなに	<ul style="list-style-type: none"><li>・国内外の大学(ODA案件を含む)・研究機関等における医療分野や科学分野の研究のために、幅広く当社装置を提供。</li><li>・サムコ科学技術振興財団を通じ、基礎・応用研究に携わる若手研究者を支援。</li><li>・京都工芸繊維大学にサムコ辻理寄附講座「先端材料科学講座」を開講。</li></ul>
6 安全な水とトイレ を世界中に	<ul style="list-style-type: none"><li>・浄水場・家庭・職場・レストラン等での流水浄化用に水銀ランプの代替光源として、深紫外線LEDを利用した浄水器が製造。深紫外線LEDの製造に当社装置が寄与。</li></ul>
7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに	<ul style="list-style-type: none"><li>・省エネの切り札である次世代パワーデバイスの材料として期待されるSiC(炭化シリコン)、GaN(窒化ガリウム)、酸化ガリウム(Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)等の加工に当社装置が寄与。</li><li>・高効率LED素子、マイクロLEDや、LD(レーザー)の製造のほか、太陽電池の研究開発用で当社装置を提供。</li></ul>
8 働きがいも 経済成長も	<ul style="list-style-type: none"><li>・当社はファブライト企業として、サプライヤーや協力工場と協業し、双方の事業発展を目指す。</li><li>・勤続年数に応じた表彰のほか、業績への貢献に応じた賞を用意。</li><li>・役職ごとの当社独自の人材育成プログラムを実施。</li><li>・多様な人材確保。(女性管理職の登用、外国籍社員の積極採用、中途採用含めた中核人材の多様性、シニア社員の活躍)</li></ul>

# サムコのSDGsの取り組み例



<b>9</b> 産業と技術革新の基盤をつくる 	<p>産業と技術革新の基盤造りのため、以下の用途等に装置を提供</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・5G関連の高周波フィルター、高周波デバイスの製造やデータセンターなどVCSEL(面発光レーザー)を含む通信用LD(レーザー)用装置の製造。</li><li>・自動運転用のセンシング技術(LiDAR)、各種センサーヤ宇宙衛星の探索用センサー機器の製造。</li><li>・有機EL、マイクロLEDの製造。</li><li>・超伝導デバイス、量子デバイスの研究開発用途。</li></ul>
<b>12</b> つくる責任 つかう責任 	<ul style="list-style-type: none"><li>・人の健康や環境を守るために当社での製造過程、製品について適正な管理を実現する。</li><li>・環境に調和するプロセス技術の開発と、製造から廃棄までを考慮した環境負荷軽減型の製品開発に努める。</li><li>・省エネルギー、省スペースを基本とした製品を通じて環境負荷を低減。 主な取り組みテーマ ①製品容積の減少、②消費エネルギーの削減、③会社消費電力量の削減、④グリーン調達、⑤廃棄物の削減</li></ul>
<b>13</b> 気候変動に 具体的な対策を 	<ul style="list-style-type: none"><li>・調達する原材料、部品について、環境影響を考慮するよう調達先に働きかけ、グリーン調達に注力。</li><li>・エネルギーの効率的な利用および3Rに取り組む。</li><li>・省エネルギー、省スペースを基本とした製品を通じて環境負荷を低減。</li></ul>
<b>16</b> 平和と公正を すべての人々に 	<ul style="list-style-type: none"><li>・コーポレートガバナンス・コードに基づいた経営を実践。</li><li>・管理職、新入社員を対象にしたコンプライアンス研修を定例的に実施。</li><li>・コンプライアンス全体を統括する組織として代表取締役社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、内部統制システムの構築、維持、向上を推進。</li></ul>

# サムコの人材育成方針



1. 仕事は楽しく、面白くあるべきである。一所懸命に楽しく仕事をして、かつ面白い。そして良い結果がついてくる。そんな楽しく、面白い日々が日常である会社とする。
2. “学ぶ”を忘れない。学ぶことを常に念頭に置き、長きに渡り己を磨くことで自らの価値を高めてほしい。特に若手社員は30代までに能力向上に勤しむ癖をつけなければならない。
3. リスキリングにより第一線で活躍できるスキルを身に付けることにより、70歳まで働く企業としていく。シニア社員が十分社会貢献できるよう再教育することを会社の使命と考える。
4. 外国籍社員の採用を増やし、若手社員の海外経験を増やすことによりグローバル人材の育成を図る。
5. 階層別の教育訓練制度(部長塾、課長塾、成長塾)を発展的に継続し、多角的な視野で経営管理できる人材の育成を図る。
6. たえず組織の新陳代謝を図り、新たな細胞(多様な人材)を積極的に登用していく。人事異動は社員の層を厚くし、組織を重層化する目的もあり、新たな能力の開拓につなげる。女性社員も大きな戦力として、管理職で活躍をしてもらえるように環境を整備する。



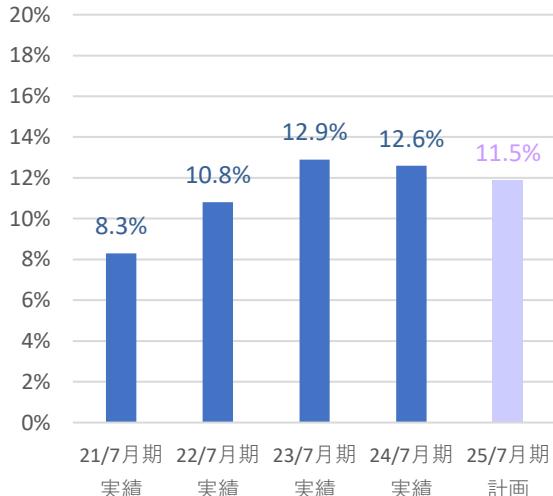
# 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

当社は、中長期的な経営指標として「装置製造原価率50%未満」「売上高営業利益率20%以上」「海外売上高比率50%以上」を掲げ、収益性と成長性を重視した経営の実現に向け対応しております。

当社の2024年7月期(第45期)のROEは12.6%であり、第46期には11.5%とする計画であります。また、「資本コスト」については、その概念や計算方法について統一的な基準が示されておらず、一般的な指標になっていないことより、当社の経営指標や開示情報には用いておりませんが、新規事業等への新たな投資については現状のROE水準を意識した経営を実践しております。

なお、当社の2024年11月1日時点のPBRは2.05倍となっており、株価についても意識した経営を継続いたします。

ROEの実績(4期分)、計画(1期分)



コーポレートガバナンス報告書(2024.11.13提出)より

# 株主・投資家との対話状況

## 基本方針

当社は、持続的な企業価値の向上のために、株主との間で建設的な対話をを行うこととしております。株主との対話につきましては、代表取締役社長 川邊 史の管掌の下、専任部署である経営企画室(2025年4月現在3名)を中心に、経理部、総務部、社長室などの関連部署と密接に連携しつつ、IR活動を行っています。また、対話に際しては内部規定に基づき未公表のインサイダー情報の管理を徹底しております。

## 対話を行った株主の概要 対象期間:2023年8月1日から2024年7月31日までの1年間

### 【機関投資家・アナリスト向け】

- ・1 on 1ミーティング 123件（国内95件、海外28件）、スマートミーティング 年3回
- ・機関投資家・アナリスト向け オンライン決算説明会 年2回（Zoomウェビナー形式／中間期3月、期末9月）

### 【個人投資家向け】

- ・株主総会後の会社説明会 年1回（10月）
- ・第45期 年次報告書(2024年10月)にて株主アンケートを実施し、その結果を第46期 中間期報告書(2025年4月)にて公表。
- ・個人投資家からの電話・メール問い合わせ対応 隨時

**投資家の皆様との建設的な対話を通じ、企業価値向上に繋げてまいりたいと考えております。**

その他、対話の実例、取締役会に対するフィードバック、取り入れた事項などはHPに掲載 ⇒ 株主・投資家との対話状況の詳細は[こちら](#)

# IRカレンダー



# お問い合わせ

サムコ 株式会社

経営企画室

E-mail : [kikaku@samco.co.jp](mailto:kikaku@samco.co.jp)

URL : [www.samco.co.jp](http://www.samco.co.jp)



Better Tomorrow Driven by Thin Film Technology